

**SEMINAR:
Plasma Prozess Technologie****am Donnerstag, den 7. April 2016
in Berlin-Adlershof****Veranstaltungsort:
SENTECH Instruments GmbH
Schwarzschildstr. 2, Berlin-Adlershof
Tel.: +49 30 6392 - 5520****Seminarprogramm**

9:00 **Begrüßung und Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailing

Beschichtungstechniken:**➤ PECVD**

9:10 **Vorstellung der SENTECH Ätz- und Beschichtungsanlagen**
Hassan Gargouri, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

9:40 **Deposition for highly uniform SiN-layers by ICPECVD**
Shahram Keyvaninia, Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik, HHI, Berlin

10:10 **Low Temperature ICPECVD deposition of silane-based and liquid precursor based oxides**
Xuemei Wang, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

10:40 Kaffeepause und Diskussion

➤ ALD

11:00 **PEALD-Abscheidungen mittels true remote Plasmaquelle und PTSA ICP Plasmaquelle**
Franziska Naumann, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

11:30 **In Situ Prozess Monitoring**
Irina Kärkkänen, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

12:00 **Deposition of thick multilayer coatings with PEALD for X-ray optics**
Umut Tunca Sanli, MPI für Intelligente Systeme, Stuttgart

12:30 Mittagessen und Diskussion

Ätztechniken:

13:30 **Ätzen von Chrom und Glas bei der POG Präzisionsoptik Gera**
Holger Hartung, POG Präzisionsoptik Gera GmbH, Gera

14:00 **Top-down fabrication of silicon nanowires**
Yordan Georgiev, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V., Nanofabrikation, Rossendorf

14:30 **Ätzen von Diamant Nanostrukturen**
Marc Ganzhorn, Universität Basel, Department Physik, Basel/Schweiz

15:00 Kaffeepause und Diskussion

15:15 **Ätzen von technischen Gläsern mit ICP RIE**
Christoph Weigel, TU Ilmenau, Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®, Ilmenau

15:45 **Schädigungsarmes Siliziumätzen mittels Gaswechselprozessen, Kryoprozessen und ICP RIE**
Ralph-Stephan Unger, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

16:15 **Alle Teilnehmer des Seminars sind zum Besuch der Applikationslabore bei SENTECH Instruments eingeladen**

17:30 *Ende des Seminars*